

集成Ptfе溢流槽无缝酸洗浴槽定制氟聚合物半导体清洗槽

货号: PL-CP388



简介

专为极致耐化学性和高纯度应用而设计的高性能PTFE溢流槽和无缝酸洗浴槽。完全可定制的集成设计确保零泄漏和最大的耐用性，满足当今所有工业运营商在苛刻的工业酸蚀刻和半导体清洗工艺中的需求。

了解更多

应用	描述	主要优势
半导体晶圆清洗	使用RCA或食人鱼蚀刻液从晶圆上关键地去除有机和无机污染物。	超高纯度确保零痕量金属污染。
光伏电池蚀刻	使用浓酸或碱溶液对太阳能级硅进行精确的表面结构化。	无缝设计抵抗结构化化学品的侵蚀性质。
金属表面酸洗	高性能去除精密金属部件和医疗植入物上的氧化物和氧化皮。	长期耐用性降低了腐蚀环境中的设备更换成本。
痕量分析实验室器皿	在要求十亿分之一 (ppb) 准确度的环境中制备和储存样品。	不浸出材料防止分析过程中的样品干扰。
电池研究与开发	测试和容纳用于下一代电池架构的电解质和腐蚀性化学品。	卓越的耐热性可安全处理放热反应。
电镀和阳极氧化	专用电镀浴槽的储罐，其中高纯度和耐化学性是强制性的。	集成溢流保持一致的溶液水平，以获得均匀涂层。
药物合成	用于生产涉及苛刻试剂的活性药物成分 (API) 的反应容器。	生物学惰性材料确保符合严格的纯度标准。
化学品储存与转移	安全容纳会降解玻璃或不锈钢容器的高纯度试剂。	坚固的壁结构防止渗透和环境污染。

参数	PL-CP388 规格详情
型号标识符	PL-CP388 系列
主要材料	100% 原生高纯度 PTFE (可选 PFA)
结构方法	全CNC整体加工 (无焊接)
设计配置	集成内外溢流槽
尺寸范围	完全根据客户规格定制
壁厚	可定制 (针对结构完整性和热传递进行了优化)
工作温度范围	-180°C 至 +260°C
化学相容性	通用 (除熔融碱金属和元素氟外)
溢流堰样式	定制 (直口、V型口或锯齿状选项)
表面光洁度 (Ra)	<0.5 μm (标准) / 可定制更高精度
排水和端口	可提供定制 NPT、法兰或卡套接头
负载能力	根据定制体积和流体密度设计
清洗协议	兼容标准洁净室和灭菌程序